## Моделирование профиля состава осевой гетероструктуры InSb/GaInSb/InSb в нитевидных нанокристаллах

© Е.Д. Лещенко<sup>1</sup>, В.Г. Дубровский<sup>2</sup>

<sup>1</sup> НТЦ микроэлектроники РАН, Санкт-Петербург, Россия

<sup>2</sup> Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

08.2

Поступило в Редакцию 12 августа 2022 г. В окончательной редакции 12 августа 2022 г. Принято к публикации 17 августа 2022 г.

Проведено теоретическое исследование процесса формирования двойной осевой гетероструктуры InSb/GaInSb/InSb в автокаталитических и Au-каталитических нитевидных нанокристаллах и рассчитаны профили состава в данной гетероструктуре. Изучено влияние на профиль состава различных параметров, в том числе температуры, концентрации сурьмы и внешнего катализатора (Au).

Ключевые слова: нитевидные нанокристаллы III-V, осевая гетероструктура, гетерограница, моделирование.

DOI: 10.21883/PJTF.2022.19.53590.19339

Нитевидные нанокристаллы (ННК) и осевые гетероструктуры на их основе представляют большой интерес, обусловленный рядом перспективных направлений их использования в оптоэлектронике и нанофотонике [1]. Так, ННК на основе сурьмы нашли применение в инфракрасных детекторах [2] и инвенторах [3]. ННК имеют множество преимуществ, в числе которых контроль морфологии [4], кристаллической структуры [5] и состава [6,7] выращиваемых наноструктур, а также возможность роста на кремниевой подложке [8]. Моделирование процесса формирования гетероструктур на основе ННК позволяет установить взаимосвязь между их свойствами и ростовыми параметрами, что необходимо для синтеза наноструктур с управляемыми свойствами.

Основным методом синтеза осевых гетероструктурных ННК является рост по механизму пар-жидкостькристалл [9]. В качестве катализатора одним из самых распространенных элементов остается золото благодаря его универсальности [10]. Так, возможность роста осевых гетероструктур InSb/GaInSb/InSb на основе Auкаталитических ННК была продемонстрирована в работе [11]. Однако в настоящее время все большую популярность набирает автокаталитический рост [12], когда катализатором роста является элемент III группы, входящий в состав выращиваемого ННК. Данный способ роста позволяет избежать нежелательного встраивания атомов Аи в ННК, которое приводит к деградации оптических и электронных свойств наноструктур. Кроме того, в рамках автокаталитического роста возможен контроль морфологии ННК за счет эффекта самофокусировки радиуса [13]. Настоящая работа посвящена моделированию профилей состава в двойной осевой гетероструктуре InSb/GaInSb/InSb на основе ННК.

Рассмотрим формирование осевой гетероструктуры на основе ННК, на вершине которого находится капля,

содержащая внешний катализатор U. При осаждении атомов B и D формируется капля BDU, из которой растет HHK BD. Замещение потока B на поток атомов A ведет к формированию четырехкомпонентного раствора ABDU и росту HHK  $A_x B_{1-x}D$ . Со временем количество атомов B в капле уменьшается, что приводит к увеличению содержания AD в HHK. Для роста гетероструктуры  $A_x B_{1-x}D/BD$  необходимо обратное замещение потоков. При формировании *i*-го монослоя количество атомов A в капле увеличится за счет потока  $V_A^i$  и уменьшится за счет встраивания атомов в монослой ( $\Delta_A^i$ ). В предположении, что контактный угол и радиус HHK не меняются, после формирования *i*-го монослоя количество атомов A в капле  $N_A^i$  окажется равным

$$N_A^i = N_A^0 + \sum_i V_A^i - \sum_i \Delta_A^i.$$
(1)

Здесь  $N_A^0$  — начальное количество атомов A в капле ( $N_A^0 = 0$ ). Количество атомов A, которые встраиваются в *i*-й монослой, равно  $\Delta_A^i = N_{\text{III}}^{\text{ML}} x(y^{i-1})$ , где  $N_{\text{III}}^{\text{ML}}$  — общее количество атомов III группы в монослое,  $y = c_A/(c_A + c_B)$ ,  $c_A$  и  $c_B$  обозначают концентрацию атомов A и B в капле соответственно. Далее  $V_A^i = v_A \Delta i^i$ , где  $v_A$  — газовый поток,  $\Delta t^i$  — время между моментами завершения формирования (*i*-1)-го и *i*-го монослоев. В предположении линейной скорости роста ( $\xi = rt$ , где  $\xi$  — номер монослоя, а r — скорость роста ННК)  $\Delta t^i = 1/r$ . Разделив выражение (1) на общее количество атомов в капле  $N_L$ , состав капли после формирования *i*-го монослоя  $y^i$  можно представить в виде

$$y^{i} = y_{0} + \frac{g}{c_{tot}} \sum_{i} (a - x(y^{i-1})).$$
 (2)

Здесь  $g = N_{\text{III}}^{\text{ML}}/N_L$  — коэффициент, зависящий от материальной системы, радиуса ННК и контактного угла [14];

E-mail: leshchenko.spb@gmail.com



**Рис. 1.** Профили состава гетероперехода InSb/GaInSb/InSb в ННК, рассчитанные при различных температурах и фиксированных  $c_{Au} = 0.15$ ,  $c_{Sb} = 0.05$ , g = 0.001, a = 1.2 и 0.2 для гетеропереходов InSb/GaInSb и GaInSb/InSb соответственно. a - b кинетическом режиме роста, b - b лимитированном нуклеацией режиме роста.



**Рис. 2.** Профили состава гетероперехода InSb/GaInSb/InSb в HHK, рассчитанные при различных концентрациях золота и фиксированных  $T = 350^{\circ}$ C,  $c_{Sb} = 0.06$ , g = 0.001, a = 1.5 и 0.5 для гетеропереходов InSb/GaInSb и GaInSb/InSb соответственно. a - в кинетическом режиме роста, b - в лимитированном нуклеацией режиме роста.

 $a = v_A / (r N_{\text{III}}^{\text{ML}})$  — безразмерный коэффициент отношения потока атомов *A* к количеству встраиваемых атомов III группы.

Зависимость x(y) может быть получена в рамках различных моделей, в частности в случаях лимитированного нуклеацией и кинетического роста. Далее мы используем приближение независимости поверхностной энергии зародыша от его состава [15]. Его влияние в случае лимитированного нуклеацией роста можно найти в [16]. Режим лимитированного нуклеацией роста предполагает, что состав монослоя *x* совпадает с составом критического зародыша и определяется уравнением [14,17]:

$$x = \frac{1}{1 + \frac{1 - y}{y}e^{-2\omega_s(x - 1/2) - b}}.$$
(3)

Здесь  $\omega_s$  — параметр взаимодействия между парами *AD* и *BD* в твердом растворе, *b* — коэффициент, зависящий от концентраций всех элементов в капле, параметров взаимодействий и химических потенциалов чистых компонентов [17]. Для расчетов используем модель регулярного раствора и полиномы Ридлиха-Кистера. В случае кинетического режима рост монослоя происходит за счет встраивания пар *AD* и *BD* согласно  $dN_{AD}/dt = W_{AD}(1 - e^{-\Delta\mu_{AD}})$  и  $dN_{BD}/dt = W_{BD}(1 - e^{-\Delta\mu_{BD}})$ , где  $N_{AD}$  и  $N_{BD}$  — число пар *AD* и *BD* в монослое,  $W_{AD}$  и  $W_{BD}$  — коэффициенты присоединения пар *AD* и *BD*,  $\Delta\mu_{AD}$  (и  $\Delta\mu_{BD}$ ) разность химических потенциалов атомов *A* и *D* (*B* и *D*) в жидкой фазе и пары *AD* (*BD*) в кристаллической фазе. Состав монослоя в кинетическом режиме роста  $x \equiv (dN_{AD}/dt)/(dN_{AD}/dt + dN_{BD}/dt)$  может быть найден из уравнения

$$x = \frac{1}{1 + \frac{W_{BD}}{W_{AD}} \frac{(1 - e^{-\Delta \mu_{BD}})}{(1 - e^{-\Delta \mu_{AD}})}}.$$
 (4)

Анализ начнем с температурной зависимости профиля состава гетероперехода. Значения параметров взаимодействия и химических потенциалов можно найти в работе [17]. Из рис. 1, b видно, что в случае лимитированного нуклеацией роста понижение температуры ведет к формированию ННК с более резким гетеропереходом. В случае кинетического режима роста (рис. 1, a) увеличение T также приводит к увеличению резкости гетероперехода InSb/GaInSb при x < 0.55 и уменьшению резкости в противоположном случае. При формировании гетероперехода GaInSb/InSb увеличение Т приводит к размыванию гетерограницы за счет длинного хвоста в области x < 0.1. При сравнении результатов двух моделей видно, что резкость гетероперехода в лимитированном нуклеацией режиме роста выше, чем в случае кинетического режима роста, за исключением случая формирования гетероперехода InSb/GaInSb при высоких Т.

Далее рассмотрим влияние концентрации Au  $(c_{Au})$ на формирование двойной гетероструктуры в ННК (рис. 2). Видно, что в случае лимитированного нуклеацией роста увеличение с<sub>Аи</sub> ведет к незначительному увеличению резкости гетероперехода и объясняется уменьшением эффекта резервуара. Из рис. 2, а видно, что в случае кинетического роста изменение профиля состава гетероперехода носит немонотонный характер: при низких значениях сАи ее увеличение приводит к размыванию гетероперехода, однако при  $c_{\rm Au} > 0.2$ дальнейшее увеличение с<sub>Аи</sub> приводит к увеличению резкости гетероперехода. Это объясняется более сильным влиянием  $c_{Au}$  на кривую x(y) по сравнению с изменением за счет уменьшения эффекта резервуара. Сравнение лимитированного нуклеацией и кинетического режимов показывает, что профили гетероперехода практически совпадают при очень малых и средних значениях с Ац.

Влияние концентрации сурьмы  $(c_{\rm Sb})$  на профиль состава осевого гетероперехода представлено на рис. 3. Видно, что в лимитированном нуклеацией случае  $c_{\rm Sb}$ 



**Рис. 3.** Профили состава гетероперехода InSb/GaInSb/InSb в HHK, рассчитанные при различных концентрациях сурьмы и фиксированных  $T = 350^{\circ}$ C,  $c_{Au} = 0.2$ , g = 0.001 и a = 1.5 и 0.5 для гетеропереходов InSb/GaInSb для GaInSb/InSb соответственно.  $c_{Sb} = 0.025$  (сплошная кривая I и штриховая кривая), 0.04 (сплошная кривая 2 и кружки), 0.06 (сплошная кривая 3 и крестики). Сплошные кривые — в кинетическом режиме роста, штриховая кривая и символы — в лимитированном нуклеацией режиме роста.

практически не влияет на профиль состава гетероперехода, что объясняется следующим: 1) зависимость состава жидкость-кристалл определяется равенством  $\Delta \mu_{AD} = \Delta \mu_{BD}$ ; 2) *с* <sub>Sb</sub> одинаково входит в разность химических потенциалов  $\Delta \mu_{GaSb}$  и  $\Delta \mu_{InSb}$ , за исключением члена, описывающего избыточную энергию Гиббса. Однако вклад двойных и тройных взаимодействий в капле относительно мал, что и объясняет небольшое расхождение кривых. В случае кинетического режима при уменьшении c<sub>Sb</sub> с 0.06 до 0.025 к 90-му монослою содержание GaSb в ННК увеличивается с  $x \approx 0.6$ до  $x \approx 0.8$ , т.е. резкость профиля гетероперехода увеличивается. При заданных параметрах при c<sub>Sb</sub> > 0.01 резкость профиля гетероперехода в случае кинетического режима роста ниже, чем при лимитированном нуклеацией росте (обратная картина наблюдается при  $c_{\rm Sb} < 0.01$ ).

Построенная модель позволяет рассчитывать профиль состава двойных осевых гетероструктур и проводить анализ влияния различных ростовых параметров на резкость границы гетероперехода. Модель применима для любой материальной системы и любого внешнего катализатора. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации параметров роста гетероструктурных ННК с резкими гетерограницами.

## Финансирование работы

В.Г. Дубровский благодарит за финансовую поддержку аналитических исследований в рамках исследовательского гранта СПбГУ (ID 93020138).

## Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

## Список литературы

- E. Barrigón, M. Heurlin, Z. Bi, B. Monemar, L. Samuelson, Chem. Rev., **119**, 9170 (2019).
   DOI: 10.1021/acs.chemrev.9b00075
- [2] C.-H. Kuo, J.-M. Wu, S.-J. Lin, W.-C. Chang, Nanoscale Res. Lett., 8, 327 (2013), DOI: 10.1186/1556-276X-8-327
- [3] A.W. Dey, J. Svensson, B.M. Borg, M. Ek, L.-E. Wernersson, Nano Lett., 12, 5593 (2012). DOI: 10.1021/nl302658y
- [4] V.G. Dubrovskii, T. Xu, A.D. Alvarez, S.R. Plissard, P. Caroff, F. Glas, B. Grandidier, Nano Lett., 15, 5580 (2015).
   DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b02226
- K.A. Dick, P. Caroff, J. Bolinsson, M.E. Messing, J. Johansson, K. Deppert, L.R. Wallenberg, L. Samuelson, Semicond. Sci. Technol., 25, 024009 (2010).
   DOI: 10.1088/0268-1242/25/2/024009
- [6] M. Ghasemi, E.D. Leshchenko, J. Johansson, Nanotechnology, 32, 072001 (2021). DOI: 10.1088/1361-6528/abc3e2
- [7] B.D. Liu, J. Li, W.J. Yang, X.L. Zhang, X. Jiang, Y. Bando, Small, 13, 1701998 (2017). DOI: 10.1002/smll.201701998
- [8] Г.Э. Цырлин, Р.Р. Резник, Ю.Б. Самсоненко, А.И. Хребтов, К.П. Котляр, И.В. Илькив, И.П. Сошников, Д.А. Кириленко, Н.В. Крыжановская, ФТП, **52** (11), 1304 (2018). DOI: 10.21883/FTP.2018.11.46588.10 [G.E. Cirlin, R.R. Reznik, Yu.B. Samsonenko, A.I. Khrebtov, K.P. Kotlyar, I.V. Ilkiv, I.P. Soshnikov, D.A. Kirilenko, N.V. Kryzhanovskaya, Semiconductors, **52**, 1416 (2018). DOI: 10.1134/S1063782618110258].
- [9] R.S. Wagner, W.C. Ellis, Appl. Phys. Lett., 4, 89 (1964).
- DOI: 10.1063/1.1753975 [10] M.E. Messing, K. Hillerich, J. Johansson, K. Deppert,
- K.A. Dick, Gold Bull., **42**, 172 (2009). DOI: 10.1007/BF03214931
- [11] S.G. Ghalamestani, M. Ek, K.A. Dick, Phys. Status Solidi C, 8, 269 (2014). DOI: 10.1002/pssr.201308331
- P. Krogstrup, R. Popovitz-Biro, E. Johnson, M.H. Madsen, J. Nygård, H. Shtrikman, Nano Lett., 10, 4475 (2010). DOI: 10.1021/nl102308k
- [13] V.G. Dubrovskii, Phys. Rev. B, 93, 174203 (2016).DOI: 10.1103/PhysRevB.93.174203
- [14] V.G. Dubrovskii, A.A. Koryakin, N.V. Sibirev, Mater. Des., 132, 400 (2017). DOI: 10.1016/j.matdes.2017.07.012
- [15] G. Wilemski, J. Phys. Chem., 91, 2492 (1987).
   DOI: 10.1021/j100294a011
- [16] E.D. Leshchenko, J. Johansson, CrystEngComm, 23, 5284 (2021). DOI: 10.1039/D1CE00743B
- [17] E.D. Leshchenko, M. Ghasemi, V.G. Dubrovskii, J. Johansson, CrystEngComm, 20, 1649 (2018). DOI: 10.1039/C7CE02201H